

半導体露光関連技術の国際会議「SPIE Advanced Lithography + Patterning」に参加

株式会社ニューフレアテクノロジー
2025年3月3日

ニューフレアテクノロジー (NFT) は、2025年2月23日から27日まで米国カリフォルニア州サンノゼ市で開催された「SPIE Advanced Lithography + Patterning」に参加しました。

本学会は、光学やフォトリソグラフィの分野における国際学会である SPIE (The International Society for Optical Engineering, 国際光工学会) が毎年開催するもので、今回もウェハ露光やフォトマスク製作に関して幅広い報告が行われました。

NFT は、マルチ電子ビーム描画装置に関する最新の研究成果について4件の発表（うち1件は共著者としての発表）を行っています。

<SPIE Advanced Lithography + Patterning 2025 での NFT 単独の発表論文>

Paper 13427-14
Multi-beam mask writer MBM-4000 for high-NA EUV era (Invited Paper)
Hiroshi Matsumoto et al.
NuFlare technology, Inc.

Paper 13427-57
Study on modeling of resist heating effect correction in multi-beam mask writers
Haruyuki Nomura et al.
NuFlare technology, Inc.

Paper 13426-144
Characterization of pattern fidelity evaluation using sine wave patterns in electron multi-beam writing
Shinichi Sasaki et al.
NuFlare technology, Inc.

以上